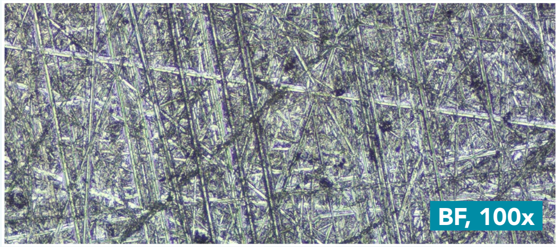
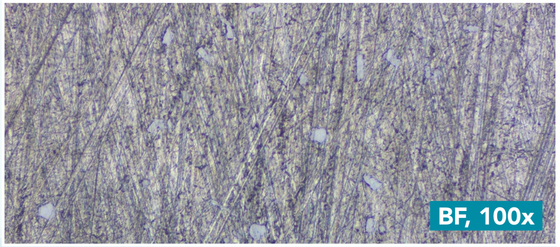
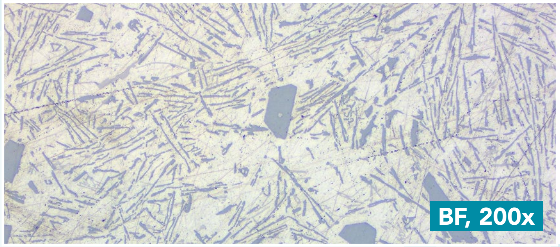
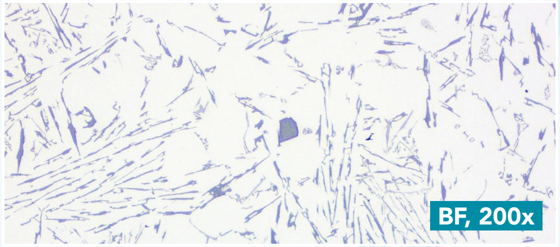
Aka-Brief **#4** 铝合金

1	Rhaco Grit P320	水	300 RPM	20 N	磨平
2	Largan 9	DiaUltra 9 µm	150 RPM	30 N	3:30 min
3	Moran-U	DiaUltra 3 µm	150 RPM	25 N	2:30 min
4	Chemal*	Colloidal Silica 50 nm Alkaline	150 RPM	15 N	2 min









图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

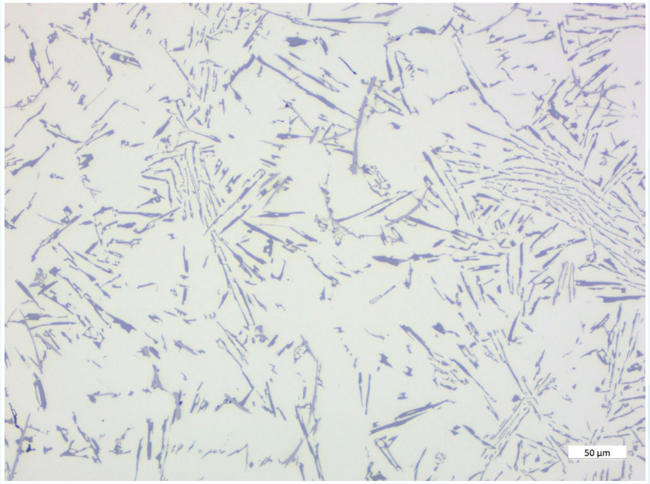
样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

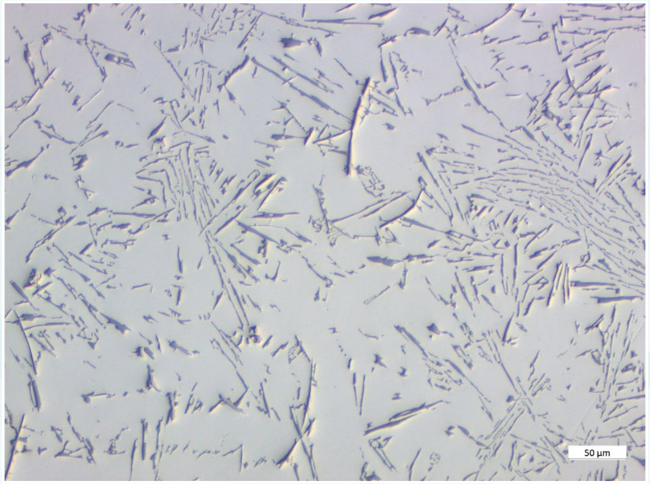
*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

Aka-Brief **#4 铝合金**

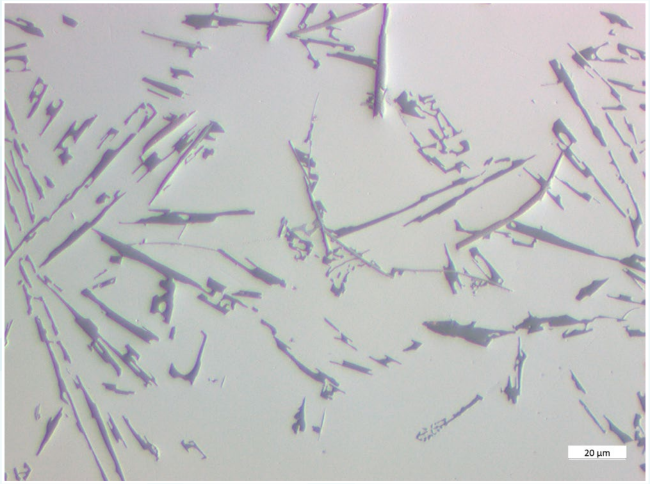
最终制样结果



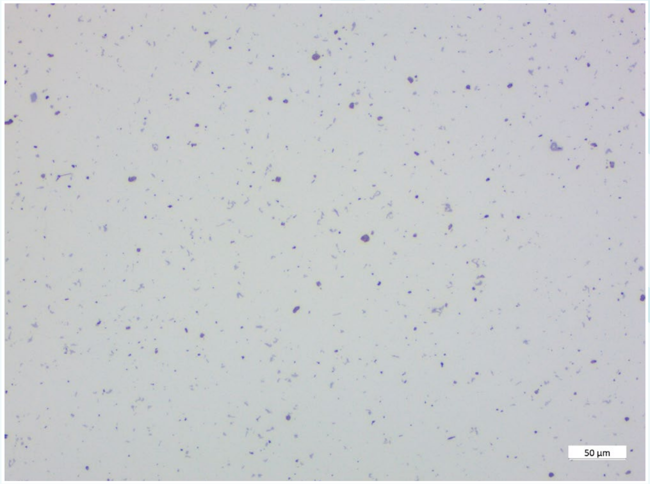
铝硅合金，明场像，200倍



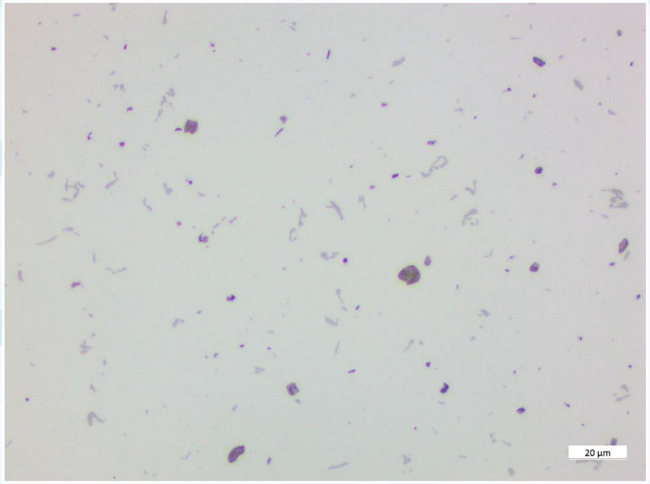
铝硅合金，微分干涉衬度像，200倍



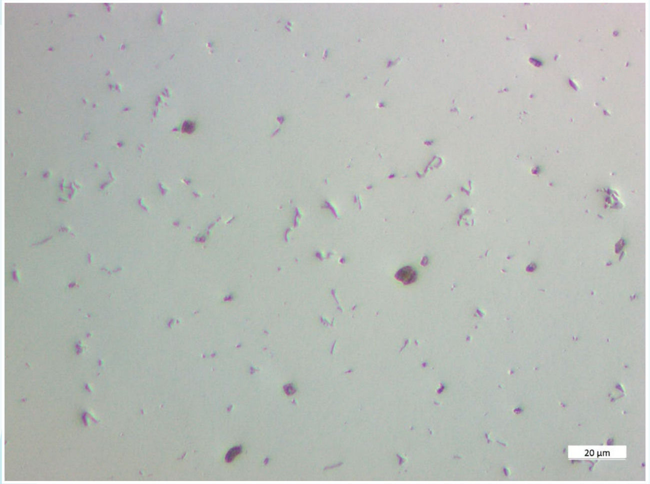
铝硅合金，微分干涉衬度像，500倍



铝镁合金，明场像，200倍



铝镁合金，明场像，500倍



铝镁合金，微分干涉衬度像，500倍

MADE IN DENMARK, 2024 - 66040502